

AirSentry® II

移動式AMCモニタリングシステム

*Mobile airborne molecular
contamination detection system
for cleanrooms*

Without measurement there is no control

クリーンルーム大気中の分子状汚染物質 (AMC: airborne molecular contaminant) は、電子デバイスや製造装置の性能に影響を及ぼし、歩留ロスや製品劣化の原因になります。適切なモニタリングが、迅速で的確なAMC汚染対策の実施につながります。

イオン モビリティ スペクトロメトリ (IMS) による移動測定が可能なAirSentry II 移動式AMCモニタリングシステムは、スピーディな汚染源の特定にとっても有効です。システムには、IMSアナライザ、コンプレッサ、エアドライヤ、CDAタンク、真空ポンプ、UPSなど、サンプリングとAMC測定に必要なコンポーネントがすべて揃っており、測定ポイントに移動後すみやかにモニタリングを開始することができます。

システムに搭載されたタッチパネル PC には Facility Net モニタリングソフトウェアがプリインストールされており、測定結果のリアルタイム表示やレポートの生成、データの保存などを行います。



**PARTICLE
MEASURING
SYSTEMS®**

a spectris company

特長

- クリーンルーム内のAMCの変動をリアルタイムに測定し、測定結果をリアルタイムに表示
- 移動測定が可能のため、AMC発生源の特定に有用
- IMSアナライザのAirSentry II AMCモニターを3台まで搭載可能
- AirSentry II AMCモニターは4つのモデル (アンモニア、アミン、酸、および塩化化合物用) から選択可能
- コンプレッサ、エアドライヤ、CDAタンク、真空ポンプをシステムに内蔵
- 電源に接続せずに、約30分の継続測定が可能 (UPSが満充電状態の場合)

AirSentry® II

移動式AMCモニタリングシステム

仕様

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| カート寸法(奥行き、幅、高さ) | 100 x 65 x 126 cm | |
| 重量 | 141kg | |
| 分析ガス接触面 | テフロン™、316ステンレス鋼 | |
| CDA品質 | 露点-60℃以下、ケミカルフィルター処理済み | |
| CDA容量 | 1000 cc/minを約30分供給可能 | |
| 移動時稼働時間 (100%充電時) | 約30分 | |
| 常設CDA接続口 (低振動モード) | 1/4インチ スウェージロック | |
| 真空源 | 25 kPa (未満)、1500 cc/min | |
| 搭載可能なIMSアナライザ (LOD - 検出限界、3 s) | AirSentry II酸、0~50 ppbv AirSentry IIアミン、0~50 ppbv AirSentry IIアンモニア、0~50 ppbv AirSentry II塩化物、0~50 ppbv | LOD = 0.2 ppbv LOD = 0.2 ppbv LOD = 0.2 ppbv LOD = 0.5 ppbv |
| 温度範囲 | 15~28℃ (動作時)、-40~50℃ (保管時) | |
| 湿度範囲 | 30~50% RH (動作時)、0~90% RH (保管時) | |
| 通信ポート | イーサネット、USB | |
| ソフトウェア | Facility Net および AirSentry II Serviceソフトウェア | |
| オペレーティングシステム | Windows® 10 | |
| 設備要件: ユーザーが供給する電源 (単相) | 110 VAC、60 Hz または 230 VAC、50 HZ | |
| CEマーキング | 適合 | |

PMS Japan

PMS日本支社

(スペクトリス株式会社 PMS事業部)

〒210-0024

神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビル4F

Tel: 044 589 3498

Fax: 044 245 5000

Email: pmsjapan@pmeasuring.com

サービスセンター (校正・修理)

Tel: 044 589 3418

Email: SVCpmsjapan@pmeasuring.com

www.pmeasuring.com/jp/



AirSentry®はParticle Measuring Systems, Inc.の登録商標です。

Windows®はMicrosoft Corporationの登録商標です。

テフロン™はChemours Companyの商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

記載されている仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

© 2018 Particle Measuring Systems, Inc. All rights reserved.

2023.11